



EPSILON

سامانه لایه نشانی رومییزی

DC Magnetron Sputtering

این سامانه برای ایجاد لایه های نازک نانومتری با روش کندوپاش مگنترونی طراحی و ساخته شده است. منبع تغذیه این سامانه از نوع ولتاژ بالای DC می باشد و امکان لایه نشانی برخی مواد فلزی نوبل مانند طلا، نقره و پلاتین را ایجاد می کند.

سادگی عملکرد این سامانه، امکان کار با آن را برای بسیاری از کاربران فراهم آورده است. این سامانه علاوه بر کاربردهای آموزشی، به عنوان دستگاه مناسب آماده سازی نمونه های SEM، محسوب می شود.

این سامانه در دو مدل Epsilon+ و Epsilon طراحی شده است. مدل Epsilon+ علاوه بر قابلیت های سامانه Epsilon، امکان عملیات سطحی با استفاده از پلاسما (Plasma Treatment) را فراهم می نماید.

مشخصات فنی:

- فشار نهایی 2×10^{-2} torr
- بخش تخلیه: پمپ روتاری دو مرحله ای
- کنترل شونده با PLC به صورت اتوماتیک
- محفظه استوانه ای پیرکس با قطر 15 cm
- اندازه گیری ضخامت بوسیله ضخامت سنج کریستالی
- دارای سامانه کنترلی با مانیتور لمسی تمام رنگی
- دارای فشارسنج پیرانی
- ولتاژ پالسی با توان بیشینه 100 وات
- منبع تغذیه DC توان 150 وات و ولتاژ قابل تنظیم
- دارای شیر سوزنی برای تنظیم مقدار گاز ورودی
- کاتد کندوپاش از نوع مگنترون با قطر تارگت 2 اینچی
- سامانه حفاظت دمایی برای جلوگیری از آسیب کاتد کند و پاش